



	English	中文	交通アクセス・地図	お問い合わせ	サイトマップ	サイト内検索
	受験生の方	広大へ留学希望の方	一般・地域の方	企業の方	卒業生の方	在学生・保護者の方

大学案内

入試情報

教育・学生生活

研究

社会連携

留学・国際交流

学部・大学院等

研究所・施設等

広報・報道

採用情報

校友会・同窓会

支援財団・基金

図書館・博物館等

大学病院

附属学校

広大公式アカウント一覧

Twitter

Facebook  
(日本語版)Facebook  
(英語版)

YouTube

行事カレンダー

ストリートビュー

キャンパスカメラ

学内ポータル

[トップページ](#) > [広報・報道](#) > [報道発表・報道された広島大学](#) > [平成19年1月-12月](#) > [パソコンの性能を5倍以上に向上できる超高速クロックの発生及び分配技術の開発](#)

パソコンの性能を5倍以上に向上できる超高速クロックの発生及び分配技術の開発

報道機関各位

平成19年2月2日  
国立大学法人広島大学  
広報グループ広報課長

記者発表会のご案内  
パソコンの性能を5倍以上に向上できる  
超高速クロックの発生及び分配技術の開発

広島大学大学院先端物質科学の佐々木守助教授のグループは、次世代の超高速半導体集積回路に対する、新しい高速クロック発生及び分配技術をエルピーダメモリと共同開発しました。

今回開発した技術は、現在の最高速プロセッサの5倍以上である数10GHz (GHzは10<sup>9</sup>回)の超高速クロックを、マイクロ・プロセッサなどの大規模半導体集積回路に適用可能にする技術です。

今後、ハイエンドパソコンを始めネットワーク・サーバやスーパーコンピュータなど、更なる高性能化が要求される分野への応用が期待でき、世界的にも注目を集める技術です。

つきましては、下記のとおり記者発表会を開催し、2月11日(火)サンフランシスコで開催される米国電気電子学会の国際固体回路会議 (IEEE INTERNATIONAL SOLID-STATE CIRCUITS CONFERENCE) で発表します。本件の報道解禁につきましては、同会議での発表日意向(現地時間13日11時15分、日本時間14日4時15分)となっておりますので、恐れ入りますが、ご協力方よろしくお願い致します。

記

日 時： 平成19年2月6日(火)13時～14時

場 所： 広島大学東広島キャンパス 本部棟4F会議室

出席者： 広島大学大学院先端物質科学研究科 助教授 佐々木 守

【お問い合わせ先】  
広島大学広報グループ 村上  
TEL:082-424-6017